

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2020年5月22日(22.05.2020)



(10) 国際公開番号

WO 2020/100924 A1

(51) 国際特許分類:
H01L 21/304 (2006.01)

SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA,
UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

(21) 国際出願番号: PCT/JP2019/044463

(22) 国際出願日: 2019年11月13日(13.11.2019)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願 2018-214179 2018年11月14日(14.11.2018) JP

(71) 出願人: 関東化学株式会社(**KANTO KAGAKU KABUSHIKI KAISHA**) [JP/JP]; 〒1030023 東京都中央区日本橋本町3丁目2番8号 Tokyo (JP).

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告(条約第21条(3))

(72) 発明者: 柏木 一樹 (**KASHIWAGI, Kazuki**); 〒1030022 東京都中央区日本橋室町2丁目2番1号 室町東三井ビルディング 関東化学株式会社内 Tokyo (JP). 大和田 拓央(**OHWADA, Takuo**); 〒1030022 東京都中央区日本橋室町2丁目2番1号 室町東三井ビルディング 関東化学株式会社内 Tokyo (JP).

(74) 代理人: 葛和 清司 (**KUZUWA, Kiyoshi**); 〒1600023 東京都新宿区西新宿6丁目2番4号 西新宿三井ビルディング17階 葛和国際特許事務所 Tokyo (JP).

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JO, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL,

(54) **Title:** COMPOSITION FOR REMOVING RUTHENIUM

(54) 発明の名称: ルテニウム除去用組成物

(57) **Abstract:** The present invention addresses the problem of providing a remover composition which can sufficiently remove ruthenium (Ru) remaining on substrates and can be inhibited from evolving RuO₄ gas. The remover composition, which is for removing ruthenium remaining on substrates, has a pH at 25 °C of 8 or higher and includes one or more pH buffer ingredients.

(57) 要約: 本発明の課題は、基板に残存するRuを十分に除去し、さらにRuO₄ガスの発生を抑制することができる除去用組成物を提供することにある。基板に残存するルテニウムの除去用組成物であって、25℃におけるpHが8以上であり、1種または2種以上のpH緩衝成分を含む、前記除去用組成物。



WO 2020/100924 A1